زوهش فيرب • • •

مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۲۰ شمارهٔ ۴، زمستان ۱۳۹۹ DOI: 10.47176/ijpr.20.4.38211

روش جدید در ساخت نانومیلههای اکسید سرب و کاربرد آن در حفاظت از پرتوهای یونساز

سپیده یزدانی دارکی'، محمد اسلامی کلانتری' و حکیمه زارع'

بخش فیزیک هسته ای، دانشکدهٔ فیزیک، دانشگاه یزد
۲. بخش حالت جامد، دانشکدهٔ فیزیک، دانشگاه یزد

پست الكترونيكي: meslami@yazd.ac.ir

(دریافت مقاله: ۴/۰۴ /۱۳۹۸ ؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳)

چکیدہ

ساخت نانومیلهٔ اکسید سرب به وسیلهٔ پیشمادههای استات سرب تری هیدرید و سدیم هیدروکسید بدون سورفکتانت در محیط آبی در دمای اتاق انجام شد. برای تحلیل نمونه از دستگاههای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیفسنج پـراش انـرژی پرتـوی ایکس (EDX)، طیفسنج تبدیل فوریهٔ فروقرمز (FTIR)، طیفسنج نوری فرابنفش_ مرئی (UV-Vis) و طیفسنج فوتولومینسانس (PL) استفاده شد. قطر میانگین نانومیلهها حدود ۳۵ میانگین طولی ۳۳ ۶ و انـدازهٔ بلورکها حـدود ۳۳ ۵۷ بـهدست آمـد. نانومیلـههای اکسید سرب تضعیفکنندهٔ خوبی برای پرتوهای گاما و بتا هستند و میتوانند در ساخت یک محافظ خوب در برابر پرتوهای یونساز به کار روند. برتـری مهـم دیگر این پژوهش، ساخت نانومیلههای اکسید سرب به روش بسیار ساده و مقرون به صرفه است.

واژههای کلیدی: اکسید سرب، نانومیله، نانومواد، ساخت شیمیایی، حفاظ تابشی

۱. مقدمه

با شناخت پرتوهای یون ساز مانند ایکس، بتا، آلفا و گاما توسط بشر، استفاده از این تابش ها به سرعت در زمینه های مختلف پزشکی و صنعت مانند روش های تشخیصی (نظیر انواع رادیوگرافی، ماموگرافی)، درمان توده های سرطانی (روش های مختلف پرتودرمانی) و نیز رادیوگرافی صنعتی گسترش یافت. بر این اساس، امروزه استفاده از پرتوهای یون ساز به امری

اجتناب ناپذیر مبدل شده است، اما از طرفی آثار زیانبار و مخرب این نوع پرتوها بر روی بافتهای زنده به اثبات رسیده است. از جمله این آسیبها، انواع سرطان، جهشهای ژنتیکی و ناباروری را میتوان نام برد [۱–۴]. بنابراین میتوان محافظهایی طراحی کرد تا افراد و تجهیزاتی که در معرض پرتوهای یونساز هستند، مقدار کمتری پرتو دریافت کنند. بسته به نوع و انرژی پرتوهای یونساز لازم است از مواد مختلف به عنوان حفاظ استفاده شود. بتا، در برخورد با عناصر سنگین انرژی زیادی از

[۱۴–۱۷] و تولید و ذخیرهٔ انرژی [۳ و ۴] مورد توجه واقع شدهاند. تاکنون پژوهش های کمی بر روی ساخت نانوساختارهای یک بعدی اکسید سرب انجام شده است. یوسفی و همکارانش در سال ۲۰۱۵، ساخت نانومیلههای اکسید سرب از طریق اکسایش ورقهٔ سرب تحت گاز اکسیژن در دمای بالای ۶۰۰ درجه سانتیگراد را انجام دادنــد [۲۸]. نانومیلــههای ســاخته شــده بــا ایــن روش قطـر متوسط nm داشتند. کرمی و همکارانش در سال ۲۰۰۸، نانومیلههای اکسید سرب را با استفاده از امواج فراصوت ساختند. در ایـن روش از سـورفکتانت بـرای رشـد نانومیل، ها و جلوگیری از کلوخ، شدن میل، ها استفاده كردند. نتيجـهٔ ايـن روش، مخلـوطي شـامل نـانوذرات و نانومیلیهها برد [۳]. سراخت نانومیلههای اکسید سرب توسط جیا و همکارش با استفاده از روش هیدروترمال در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد انجام شد [۲۵]. نانومیلههای حاصل تـک بلـور و دارای قطرهـای بـین ۴۰ تـا ۱۲۰ نـانومتر بودند. ساخت نانومیلههای اکسید سرب با روش شیمیایی حالت جامد در حضور سورفكتانت پلي اتيلن گليكول انجام شد [۲۷]. نانومیلهٔ حاصل دارای قطری بین ۴۰ nm تا ۱۴۰ nm بود. در این پژوهش برای اولین بار بدون استفاده از هیچ سورفکتانتی نانومیلههای اکسید سرب به روش رسوبدهی شیمیایی، در دمای اتاق و در محیط آب ساخته شد. روش انجام شده تکرارپذیر است. نانومیلههای ساخته شده به صورت قرص تهیه و میزان تضعیف آن در مقابل پرتوهای گاما و بتا بررسی شد.

۲. بخش تجربی ۱.۲. مواد و تجهیزات

در این پژوهش از پیشمادههای استات سرب تری هیدرید^۱، Pb(CH_rCOO)_۲.۳H_rO، (با درصد خلوص ۹۹/۵) از شرکت سیگما آلدریچ، سدیم هیدروکسید، NaOH (با درصد خلوص ۹۹) از شرکت مرک آلمان، آب مقطر و اتانول (با درصد

دست میدهد و هر چه حفاظ از عناصر سنگینتری تشکیل شده باشد، احتمال توليد فوتونهاي ايكس ترمزي افزايش مىيابد. پس مناسبترين حفاظ بايد از سه لايه، لايهٔ اول پلاستیک، لایهٔ دوم مادهای با عدد اتمی کوچکتر (مس و آلومینیوم) و لایهٔ سوم مادهای با عدد اتمی بزرگ (سرب) تشکیل شده باشد. پرتوهای ایکس و گاما، از دسته امواج الکترومغناطیسیاند که با عبور از ماده، ضمن یونش محیط جذب ماده میشوند و یا بخشی از انرژی خود را از دست میدهند. این پرتوها با برخورد با عناصر فلزی با چگالی بالا مانند آهن، سرب و تنگستن تضعیف میشوند [۳–۶]. در بین مواد، سرب به دلیل داشتن عدد اتمی و چگالی بالا (المربع (المالي المعاوم در برابر خوردگی، فراوانی و ارزان (المربع) قیمت بودن (نسبت به تنگستن) آن را به یک محافظ سودمند در مقابل پرتوهای ایکس و گاما تبدیل کرده است [۷] . در دههٔ اخیر، امکان ساخت نانوذرات اکسید سرب (PbO) [۸-۱۳] و کاربرد آن در حفاظسازی برای تضعیف یا حذف پرتوهای یونساز فراهم شده است [۱۴–۱۷]. بر طبق گزارشها، نانوذرات به دليل داشتن نسبت سطح به حجم بالا، توانايي جذب اغلب پرتوها را دارند که این امر سبب افزایش تضعیف می شود [۷ و ۱۸]. همچنین از نانوذرات اکسید سرب می توان در ساخت نانوکامپوزیتها به منظور طراحی محافظهای سبک و مؤثر پرتوهای یونساز استفاده کرد [۱۹ و ۲۰]. در نانوكامپوزيتها علاوه بر بستر پليمر، نانوذرات به عنوان مواد پركننده در بستر پليمر نيز مي توانند نقش تضعيف كننده پرتوهای یونساز را داشته باشند [۷ و ۱۹].

از جمله پراسنجهایی که می تواند بر میزان تضعیف پر توها مؤثر باشد شکل نانوساختاری عناصر مورد استفاده در حفاظ است [۲۱–۲۴]. تاکنون از نانوساختارهای یک بعدی و دو بعدی اکسید سرب به عنوان حفاظ پر توهای یونساز، گزارشی منتشر نشده است. نانوساختارهای یک بعدی به دلیل داشتن نسبت سطح به حجم بالا و خواص نوری و الکتریکی منحصر به فرد، برای کاربرد در ادوات الکترونیک نوری [۲۵–۲۸]، حفاظ امواج الکترومغناطیس

^{1.} Lead Acetate Trihydrate



شکل ۱. (الف) تصویر SEM، (ب) نمودار توزیع قطر و (ج) طیف EDX نانومیلههای اکسید سرب.

خلوص ۹۶) بدون هیچ خالص سازی، استفاده شد. اندازه، شکل و ساختار نمونه حاصل با استفاده از میکرو سکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل VEGAT TESCAN ساخت کشور چک بررسی شد. از دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) مدل YertPro X ساخت کشور هلند، برای مطالعه و تعیین ساختار بلوری نانومیله ها استفاده شد. تحلیل عنصری نمونه ها با کمک بلوری نانومیله ها استفاده شد. تحلیل عنصری نمونه ها با کمک طیف سنج پراش انرژی پرتوی ایکس (EDX) مدل طیف سنج پراش انرژی پرتوی ایکس (FTIR) مدل استفاده از طیف سنج تبدیل فوریهٔ فروقرمز (FTIR) مدل شناسایی شدند. برای بررسی خواص نوری از طیف سنج نوری فرابنفش – مرئی (UV-Vis) (Avante AvaSpec-۲۰۴۸) ساخت کشور هلند و طیف سنج فوتولومینسانس (PL) (IV-Vis) کشور هلند و طیف سنج فوتولومینسانس (PL) (IV-Vis)

از دستگاه پرس ساخت شرکت شرق آزما برای ساخت قرص از نمونههای پودری استفاده شد. برای بررسی میزان تضعیف قرصهای حاصل، از آشکارساز پنجرهای گایگر- مولر Leybold Didactic ساخت کشور آلمان، چشمهٔ قلمی شکل رادیوم ۲۲۶ و شمارندهٔ Leybold Didactic ،P ساخت کشور آلمان، استفاده شد.

۲.۲. روش آزمایش

ابتدا mol ۵٫۰ استات سرب تری هیدرید در ۵۰ mL آب مقطر روی همزن مغناطیسی اضافه شد. سپس به محلول حاصل قطره

قطره محلول سدیم هیدروکسید با غلظت (M (۹/۵)، اضافه شد تا pH محلول به ۹ برسد. سپس نمونهٔ حاصل به مدت ۷ ساعت در دمای محیط بر روی همزن قرار گرفت. در طی این فرایند ابتدا محلول شیری رنگ و سپس رسوب سفید رنگی ایجاد شد. نمونهٔ حاصل پس از فیلتر شدن سه مرتبه با آب و سه مرتبه با اتانول شستشه و به مدت ۲ ساعت در گرمکن با دمای $3^{\circ \circ 1}$ قرار گرفت تا خشک شود. در نهایت، پودر حاصل در کوره با فرار گرفت تا خشک شود. در نهایت، پودر حاصل در کوره با ودر زرد رنگی، حاصل شد. برای بررسی میزان تضعیف پودر حاصل، g ۴/۰ از پودر اکسید سرب به کمک دستگاه پرس به قرص هایی به ضخامت mm ۱ تولید شد. با طراحی چیدمانی از شکارساز گایگر– مولر، چشمهٔ قلمی شکل رادیوم ۲۲۶ و شمارندهٔ q، تضعیف پرتوهای گاما و بتای حاصل از چشمه

۳. نتايج و بحث

شکل ۱ به ترتیب از راست به چپ تصویر SEM، نمودار توزیع قطر نانومیلهها و طیف پراش انرژی پرتو ایکس از نمونهٔ ساخته شده را نشان میدهد. بر طبق تصویر SEM (شکل ۱. الف)، نانومیلهها قطر متوسط ۳۰ م و طول متوسط μm ۶ دارند. بر طبق نمودار توزیع قطر نانومیلهها (شکل ۱. ب)، نانومیلهها اندازهای بین ۳۰ nm است. طیف EDX در شکل ۱. ج، نشان



شکل ۲. الگوی پراش اشعهٔ ایکس نانومیله اکسید سرب.

محاسبه می شود، b ضخامت لایهٔ نازک و T ضریب عبور است. برای گاف انرژی مستقیم، ۵/۵ = n در نظر گرفته می شود. گاف انرژی اپتیکی برای نانومیله ها ۲/۶ eV تخمین زده شد. در طیف فوتولومینسانس قله های واقع در ۳۸۸ nm و ۶۴۰ ناشی از این ماده به ترتیب مربوط به گاف انرژی اپتیکی و تله های سطحی نانومیله ها هستند.

ساخت نانومیلهٔ اکسید سرب به روش رسوب دهی شیمیایی منجر به تولید پودر زرد رنگی شد که با استفاده از دستگاه پرس، قرصهایی با ضخامت ۱ mm ساخته (شکل ۵) و میزان تضعیف این قرصها اندازه گیری شد. طرحواره ای از نحوهٔ قرار گیری نمونه، چشمه و آشکارساز در شکل ۶ نشان داده شده است. نتایج نشان داد تنها با قرار دادن قرص با ضخامت ۱ mm میزان تضعیف ۶۳ درصد است و با افزایش ضخامت تا ۸ mm میزان تضعیف کل به ۷۷ درصد می رسد.

ضریب تضعیف خطی مادهٔ جاذب پرتو گاما، از رابطهٔ ۳ محاسبه می شود [۲۴ و ۳۲].

 $\mu = (1/x) \operatorname{Ln}(I_{\circ}/I) , \qquad (\Upsilon)$

که x ضخامت نمونه، I، و I به ترتیب شدت پرتوهای ورودی به آشکارساز بدون حضور جاذب و با حضور جاذب است. شکل ۷ نمودار (Ln(I،/I بر حسب ضخامت قرص را نشان میدهد. از نتایج حاصل، ضریب تضعیف خطی قرصهای



$$D = \frac{\delta / 4\lambda}{\beta \cos \theta},\tag{1}$$

CuKα متوسط اندازهٔ بلورک، λ طول موج تابشی خط CuKα موج تابشی خط λ (بر حسب λ مرادیان) و θ زاویهٔ پراکندگی براگ است. اندازهٔ متوسط بلورک برای این نمونه، Δ value تخمین زده شد و سپس متفاوت بودن اندازهٔ بلورکها با ابعاد نانومیلهها را می توان به ساختار چند بلوری و عدم تک بلوری بودن نانومیلهها مر تبط دانست.

از پودر حاصل به منظور شناخت پیوندهای گروههای عاملی نانومیلهها، طیف FTIR (شکل ۳) در محدودهٔ ^۱-۲۰۰۰ هرفته شد. شکل ۳ تحلیل FTIR نمونهٔ پودر تولید شده را نشان میدهد که قلههای کمتر از ^۱-۲۰۰۰ ۲۰۰۰ مربوط به ارتعاش کششی O-Pb است. قله در ^۱-۳۰ ۳۶۷۰ مربوط به مد کششی OH است که نشان از وجود آب بر روی سطح نانومیلهها است. قلههای ^۱-۲۰۲۲ و ^۱-۲۵۹ مربوط به مدهای ارتعاشی متقارن و غیرمتقارن O-C است [۳۰].

ویژگیهای نوری نانومیلههای اکسید سرب با استفاده از طیفهای جذب و فوتولومینسانس^۱ در شکل ۴ بررسی شد. در طیف جذب، قلهٔ نانومیلههای اکسید سرب در ۳۸۴ واقع شده است. در این نمونه قلهٔ دیگری مشاهده نمی شود که نشان میدهد محصول ساخته شده فقط اکسید سرب است. اکسید سرب گاف انرژی اپتیکی دارد که گاف انرژی اپتیکی نانومیلهها با استفاده از طیف جذب UV-Vis از رابطهٔ ۲ محاسبه شد [۳۱]. (ماں) = A (hu-Eg)ⁿ, (۲) که A ثابت جذب، ۱۰ انرژی فوتون و g گاف انرژی اپتیکی است. $\alpha = 1/d \ln(1/T)$

^{1.} Photoluminescence



Wavenumber (cm⁻¹)

شکل ۳. طيف FTIR نانوميله اکسيد سرب.



شکل ۴. طیفهای UV-Vis و فوتولومینسانس نانومیلههای اکسید **شکل ۵**. قرص حاصل از نانومیله اکسید سرب زرد رنگ. سرب.

ساخته شده حدود ^۱ ۰٬۰۶۶ m^۰ بهدست می آید.

۴. نتیجه گیری

به دلیل افزایش کاربرد پرتوهای یونساز در صنعت و پزشکی، استفاده از حفاظ می تواند آسیبهای ناشی از پرتوهای یونساز بر روی بافتهای زنده و تجهیزات را کاهش دهد. در این پژوهش، به منظور تضعیف پرتوهای یونساز به کمک سرب، ابتدا نانومیلههای اکسید سرب به روش رسوبدهی شیمیایی در دمای اتاق و در محیط

آب، بدون نیاز به سورفکتانت (برای اولین بار) با قطر متوسط ۳۰ ۳۳ ساخته شد. سپس با ساخت قرص با ضخامتهای ۱ تا ۳۸ میزان تضعیف پرتوهای ناشی از چشمهٔ رادیوم ۲۲۶ اندازه گیری شد. بیشترین میزان تضعیف در ضخامتهای اولیه حدود ۶۳ درصد مشاهده شد که این نشان دهندهٔ تضعیف نسبتاً خوبی برای این پرتوها است. ضریب تضعیف در این نمونه برای فوتون ورودی ^{۲۰}۳۵ ۶۶ (۰۰ بهدست آمد.





شکل ۶. طرحوارهای از چیدمان نمونهٔ ساخته شده، چشمه و **شکل ۷**. نمودار لگاریتمی شدت بر حسب ضخامت قرصر آشکارساز.

قدردانی

نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر صمیمانه خود را از همکاران

Chemistry 9, 2 (2012) 705.

- 14. N Z N Azman, S A Siddiqui, R Hart, and I M Low, Journal of Applied Polymer Science 128, 5 (2013) 3213.
- 15. P Kaur, D Singh, and T Singh, *Nuclear Engineering* and Design **307** (2016) 364.
- N Singh, K J Singh, K Singh, and H Singh, *Radiation Measurements* 41, 1 (2006) 84.
- 17. N Chanthima, J Kaewkhao, C Kedkaew, W Chewpraditkul, A Pokaipisit, and P Limsuwan, *Progress in Nuclear Science and Technology* **1** (2011) 15.
- 18. S Kathirvelu, L D'souza, and B Dhurai, *Indian Journal of Fibre & Textile Research* **34** (2009) 267.
- A D Wrixsion, I Barraclough, and M J Clark, *"Radiation, people and the environment"*. International Atomic Energy Agency, Austria (2004).
- 20. M S Al-Buriahi, F I El-Agawany, C Sriwunkum, H Akyildirim, H Arslan, B T Tonguc, R El-Mallawany and, Y S Rammah, *Physica B: Condensed Matter* 581 (2020) 411946.
- 21. K C Chen, C W Wang, Y I Lee, H, and G Liu, "Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects" **373**, 1-3 (2011) 124.
- 22. S Ghasemi, M F Mousavi, M Shamsipur, and H Karami, *Ultrasonics Sonochemistry* **15**, 4 (2008) 448.
- M M Kashani-Motlagh and M K Mahmoudabad, Journal of Sol-Gel Science and Technology 59, 1 (2011) 106.
- 24. L Shi, Y Xu and Q Li, *Crystal Growth and Design* **8**, 10 (2008) 3521.

- Z M Shafka, A E Hannora, and M M Sherif, International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology, Tech 3 (2015) 1046.
- 3. H Karami, M A Karimi, S Haghdar, A Sadeghi, R Mir-Ghasemi, and S Mahdi-Khani, *Materials Chemistry and Physics* **108**, 2-3 (2008) 337.
- H Karami and M Ghamooshi-Ramandi, International Journal of Electrochemical Science, Sci. 8 (2013) 7553.
- R Yousefi, A K Zak, F Jamali-Sheini, N M Huang, W J Basirun, and M Sookhakian, *Ceramics International* 40, 8 (2014) 11699.
- 6. N Mythili and K T Arulmozhi, *Applied Physics a Materials Science & Processing* **118**, 1 (2015) 261.
- 7. S Nambiar and J T Yeow, ACS Applied Materials & Interfaces 4, 11 (2012) 5717.
- 8. M Alagar, T Theivasanthi, and A K Raja. ArXiv Preprint ArXiv **1204**, 0896 (2012) 1.
- M. Salavati-Niasari, F Mohandes, and F Davar, Polyhedron 28, 11 (2009) 2263.
- 10. K T Arulmozhi and N Mythili, *AIP Advances* **3**, 12 (2013) 122122.
- 11. M A Shah, International Journal of Biomedical Nanoscience and Nanotechnology **1**, 1 (2010) 3.
- 12. U K Bangi, W Han, B Yoo, and H H Park, *Journal of Nanoparticle Research*. **15**, 11 (2013) 1.
- 13. A V Borhade, D R Tope and B K Uphade, Journal of

Metals **196** (2014) 68.

- 30. D Geetha and T Thilagvathi, *Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures* **5**, 1 (2010) 297.
- 31. N Mythili and K T Arulmozhi, *International Journal* of Scientific & Engineering Research **5**, 1 (2014) 412.
- 32. K H Al-Attiyah, A Hashim and, S F Obaid, International Journal of Plastics Technology 23, 1 (2019) 39.
- 25. B Jia and L Gao, *Materials Chemistry and Physics* **100**, 2-3 (2006) 351.
- 26. H Arami, M Mazloumi, R Khalifehzadeh, and S K Sadrnezhaad, *Journal of Alloys and Compounds* **466**, 1-2 (2008) 323.
- 27. Y L CaO, D Z Jia, L Liu, and J M LuO, *Chinese Journal of Chemistry* **22**, 11 (2004) 1288.
- 28. R Yousefi, F Jamali Sheini, A Saaedi and M Sains, *Malaysiana* 44, 2 (2015) 291.
- 29. S H Hosseini, M Askari and S N Ezzati, Synthetic